プロトンマイクロビーム照射による SiC 中の発光中心の形成

Formation of Luminescent Center in SiC by Proton Microbeam Irradiation

^O本多 智也 ^{1,2}、Kraus Hannes^{2,3}、加田 涉⁴、小野田 忍 ²、春山 盛善 ^{2,4}、佐藤 隆博 ²、江夏 昌志 ²、

神谷 富裕²、川端 駿介².4、三浦 健太⁴、花泉 修⁴、土方 泰斗¹、大島 武²

(1. 埼玉大学、2. 原子力機構、3. Wurzburg 大学、4. 群馬大学)

^oT. Honda^{1,2}, H. Kraus², W. Kada⁴, S. Onoda², M. Haruyama^{2,4}, T. Sato², M. Koka²,

T. Kamiya², S. Kawabata^{2,4}, K. Miura⁴, O. Hanaizumi⁴, Y. Hijikata¹, T. Ohshima²

(1.Saitama Univ., 2.JAEA, 3.Uni. Würzburg, 4.Gunma Univ.)

E-mail: honda@opt.ees.saitama-u.ac.jp

【はじめに】これまでに我々は、MeV 級のエレクトロンビームを用いて SiC 中に単一光子源とし て働く発光中心を形成できることを報告してきた[1]。MeV 級のエレクトロンビームの飛程は基板 を貫通するほど長いため、基板中に均一に欠陥を導入することが可能である。一方、MeV 級のイ オンビームの場合、飛程が数〜数十マイクロメートルであり、結晶中の局所位置に欠陥が導入さ れる。従って、発光中心の生成位置や濃度からイオンビームの照射位置や照射量を見積もる検出 器としての応用が期待できる。これまで我々は、ダイヤモンド中の発光中心として知られる窒素-空孔センターを用いることでイオンビームの飛跡検出が可能であることを見出している[2]。大口 径ウェハが量販化されている SiC においても、このような応用が可能であれば材料供給の観点か ら魅力的である。しかし、SiC 結晶中の照射欠陥を検出器応用の観点から調べた例が無い。そこ で本研究では、プロトンマイクロビーム照射を行った SiC 結晶の共焦点レーザー走査型蛍光顕微 鏡(CFM)観察を行い、発光中心の分布に関する知見を得た。

【実験及び結果】試料には半絶縁性(SI)六方晶(4H)SiC 基板を用い、室温にて 1.7 MeV のエネルギ ーでビーム収束径 1 µm のプロトンマイクロビームを 1×10⁸~1×10¹⁶/cm²の照射量で格子状に照 射した。フォトルミネッセンス(PL)の励起光として波長 532 nm のレーザーを用い、室温において、 CFM により PL マッピング及び各測定点での PL スペクトルを測定した。

Fig.1 にプロトンマイクロビームを照射量 1×10¹⁶/cm²で格子状に照射した試料の断面 PLマッピング測定結果を示す。SiC 結晶の表面から約 24 μ m の深さまで発光中心の形成が確認され、これはモンテカルロシミュレーションにより求めた 1.7 MeV プロトンビームの飛程(24.7 μ m)と良い一致を示す。Fig.2 に Fig.1 に示した点(a), (b)における室温 PL スペクトルを示す。点(a)においてのみ840~960 nm の範囲にシリコン空孔(V_{si})に起因すると思われる、V ラインと呼ばれる発光ピークが観測された。これらの結果から、SiC 結晶中の V_{si}を指標としてイオンビーム照射位置や侵入深さを特定する検出器としての応用が可能といえる。



Fig1:Confocal map(X-Z scan) excited with 532 nm at RT for 4H-SiC irradiated with 1.7 MeV-protons at 1×10^{16} cm⁻².



Fig2:PL spectra excited with 532 nm at RT for 4H-SiC irradiated with 1.7 MeV-protons at 1×10^{16} cm⁻²(a). PL spectra for non-irradiated areas (b) is also shown in the figure.

[1] 例えば、S. Castelletto *et al*, Nature Materials **13**,151-156(2014).

[2] 例えば、S.Onoda *et al*, Physics Status Solidi A **212**, 2641–2644 (2015). 【謝辞】本研究の一部は科研費基盤 B (26286047) 及び

科研費基盤C(26420877)を用いて行われた。